

# 次微米結構製造方法

本院覽號

公告日期

智財權狀態

02T-1030511

know-how

## 摘要

一種特殊的製程方式，於透光材料上鍍金屬薄膜，利用雷射再加上離子束蝕刻方式，製做出次微米結構圖型。此種方法可做出小至數百奈米等級之圖型。如再搭配常見之黃光微影製程，即可大量製作出次微米等級之材料元件。

## 技術優勢

一般如要製作光學或生醫元件，若要達到次米等級，須利用極為昂貴之電子束曝光製程技術，且無法大量製造。本製程技術可用常見之黃光製程，做出一般無法達到之次微米精度，價格便宜且可大量製造相關元件。

## 應用範圍

需達次微米結構精度之元件，如光學元件，生醫晶片，或超音波元件等。

## 創作人

薛韻馨、李固斌、陳志挺、郭白嘉、賴水金



中央研究院  
ACADEMIA SINICA